



## سنتز نانومیله‌های ZnO به روش همرسوبی و حساس نمودن آن با تتراکیس -کربوکسی فنیل) پورفیرین و کمپلکس قلع آن به منظور افزایش فعالیت فتوکاتالیزور در نور مرئی

سولماز زرگری<sup>\*</sup>، مرضیه یعقوبی برجانی و رحمت‌اله رحیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، تهران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۲/۰۳/۱۲، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۳/۰۴/۲۸، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۳/۰۵/۰۷

### چکیده

در این مقاله، نانومیله‌های اکسید روی پس از بهینه نمودن پارامترهای pH، دما و زمان رفلaks و فرآیند بازیخت به شیوه همرسوبی سنتز گردید. نانومیله‌های حاصل با قطر متوسط ۹۰ nm دارای ساختار کریستالی ورتیت هگزاگونال می‌باشند. به منظور بهره‌برداری بیشتر از نور مرئی در واکنش‌های فتوکاتالیزوری، برای اولین بار نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده با ترکیبات پورفیرینی فعال در ناحیه ZnO می‌رسی حساس شدند. فتوکاتالیزورهای حاصله از طریق آنالیزهای DRS، FT-IR و SEM مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری ترکیبات سنتز شده از طریق تخریب نوری آلاینده‌های رنگی متیلن بلو و متیل اورانث انجام گرفت. نتایج نشان دادند که ZnO حساس شده با پورفیرین قادر به تخریب ۸۹ درصد از آلاینده رنگی متیلن بلو در مدت زمان ۲۴۰ دقیقه تحت تابش نور مرئی شد. بنابراین ترکیبات پورفیرین در فعال‌سازی فتوکاتالیزور اکسید روی در ناحیه مرئی بسیار موثر می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: پورفیرین، نانومیله‌های اکسید روی، آلاینده آلی، فرآیند فتوکاتالیزوری.

بنابراین تصفیه پساب‌های صنعتی حائز اهمیت فراوان می‌باشد. روش‌های تصفیه قدیمی اکثراً آلاینده‌ها را از فازی به فاز دیگر منتقل می‌کند ولی قادر به تخریب آنها نیستند [۱]. اخیراً فرآیند فتوکاتالیزوری به عنوان یک روش سبز در تصفیه آب از آلاینده‌های آلی و معدنی بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۲، ۳]. در فرآیند فتوکاتالیزوری به روش‌های مختلف، گونه‌های فعلی مانند رادیکال هیدروکسیل (OH) و اکسیژن آیون رادیکال (O<sub>2</sub><sup>-</sup>) تولید می‌شود [۴]. چنین گونه‌های فعلی خاصیت

### ۱- مقدمه

سالانه در جهان انواع گوناگونی از رنگ‌های آلی به پساب‌های حاصل از کارخانجات رنگرزی وارد می‌شود. صنایع رنگرزی که یکی از مصرف کنندگان آب به شمار می‌روند، دارای مقدار قابل توجهی پساب هستند و این پساب‌ها حاوی مقدادر قابل توجهی از آلاینده‌های رنگی می‌باشند. وجود مواد سمی در پساب‌های صنعتی، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست آبی تحمیل می‌نماید.

\* عهدهدار مکاتبات: سولماز زرگری

نشانی: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، تهران

تلفن: szargari@iust.ac.ir، ۰۲۱-۷۷۴۹۱۲۰۴، دورنگار: ۰۲۹۰-۷۷۲۴۰۲۹۰

ترکیبات دیگر نظیر برخی فلزات و بعضی عناصر [۱۷، ۱۸] و همچنین حساس‌سازی با ترکیبات فعال در ناحیه مرئی [۱۹] اشاره نمود. پورفیرین‌ها و متالوبورفیرین‌ها از جمله رنگ‌های قوی می‌باشند که به عنوان جاذب قوی نور مرئی مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۲۰-۲۳]. پورفیرین‌ها بواسطه دارا بودن نوار سوت قوی در ۴۰۰ nm و چهار نوار Q در محدوده ۴۰۰-۷۰۰ nm در طیف UV-Vis مربوط به خود می‌توانند طیف وسیعی از نور خورشید را جذب کنند. بعلاوه این ترکیبات در مقایسه با سایر رنگ‌ها پایداری قابل ملاحظه‌ای را در حضور نور دارند [۷]. پورفیرین‌ها بواسطه جذب قوی نور مرئی بطور وسیعی در سل‌های خورشیدی حساس شده با رنگ بکار رفته‌اند [۲۴]. پورفیرین‌ها در فرآیندهای پرتو درمانی نیز بسیار مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۲۵-۲۸]. در این فرآیند انرژی آزاد شده از پورفیرین پس از تهییج نوری به اکسیژن یکتایی حاصله اکسیژن یکتایی حاصل می‌گردد. اکسیژن یکتایی حاصله بسیار فعال بوده و می‌تواند به عنوان عامل منهدم کننده سلول‌های سرطانی عمل نماید. نیمه هادی حساس شده با پورفیرین، قادر به تخریب آلاینده‌ها در نور مرئی بوده‌اند. به عنوان مثال گزارش شده است که  $TiO_2$  حساس شده با پورفیرین مس (II) قادر به تخریب آلاینده‌های آلتی با بازده مناسب بوده است [۲۹-۳۱]. در تحقیق حاضر، نانومیله‌های اکسید روی پس از بهینه کردن پارامترهای pH، دما و زمان رفلکس و فرآیند بازپخت، به شیوه همروسوبی سنتز گردید. به منظور بهره‌برداری بیشتر از نور مرئی، برای اولین بار نیمه هادی‌های مذکور توسط ترکیبات فعال در ناحیه مرئی تتراکیس (۴-کربوکسی فنیل) پورفیرین (TCPP) و کمپلکس قلع آن (SnTCPP) حساس شد. فعالیت فتوکاتالیزوری ترکیبات سنتز شده در تخریب نوری دو آلاینده رنگی متیل اورانث و متیلن بلو بررسی گردید و مکانیسم فعالیت فتوکاتالیزوری ترکیبات مذکور و نقش ترکیبات پورفیرین مورد بحث قرار گرفت.

## ۲- فعالیت‌های تحریبی

### ۲-۱- سنتز نانومیله‌های $ZnO$

به منظور سنتز نانومیله‌های اکسید روی، محلول آبی نیترات روی شش آبه و هگزامتیلن تترآمین به حجم و

اکسیدکنندگی قوی داشته و توانایی تخریب آلاینده‌های آلتی را دارند [۵]. در این فرآیند، فتوکاتالیزور نقش اصلی واکنش را بر عهده دارد. فتوکاتالیزورها عمدها ترکیبات نیمه رسانا می‌باشند [۶]. ساختار الکترونی نیمه رسانا شامل یک نوار والانس (VB) پر شده و یک نوار رسانش (CB) خالی می‌باشد. با تابش نور با انرژی فوتون ( $h\nu$ ) معادل و یا بیشتر از انرژی گاف نیمه رسانا، یک الکترون از نوار والانس به نوار رسانش منتقل می‌شود. در اثر این تهییج الکترون یک حفره در نوار والانس بر جای می‌ماند [۷]. حفره تولید شده در نوار والانس نیمه رسانا، بعد از واکنش با آب تولید رادیکال‌های هیدروکسیل می‌نماید. از طرف دیگر الکترون موجود در نوار هدایت نیمه رسانا اکسیژن موجود در محیط را به اکسیژن آنیون رادیکال ( $O_2^-$ ) تبدیل می‌نماید [۸]. گونه‌های رادیکالی فعال حاصله قادرند به مولکول‌های آلتی از طریق گرفتن هیدروژن و یا افزایش به پیوند دوگانه حمله کنند و محصولات بی‌خط آب و دی‌اکسید کربن را تولید کنند. فتوکاتالیزورهای متعددی نظیر  $CuO$ ,  $WO_3$ ,  $ZnO$  و  $TiO_2$  در فرآیندهای فتوکاتالیزوری بکار رفته‌اند [۹-۱۲].  $ZnO$  یک نیمه هادی با باند گپ وسیع  $3/2\text{ eV}$  می‌باشد. این نیمه رسانا دارای ساختار پایدار و رتیزت است [۱۳]. در میان تمام نانوساختارهای یک بعدی،  $ZnO$  به علت تحرک بالای الکترون‌های رسانش و نیز پایداری شیمیابی و گرمایی بالا مورد توجه تحقیقات بسیاری قرار گرفته است [۱۴]. فعالیت فتوکاتالیزوری، الکتریکی، اپتوکاترونیکی و فرآیندهای فتوشیمیابی  $ZnO$  بسیار مورد بررسی قرار گرفته است [۱۵]. با این وجود پارامترهای گوناگونی نظیر عدم پایداری در محلول تحت تابش نور فرابینخش، بازترکیب بالای جفت الکترون-حفره تولید شده در این ترکیب و فعالیت آن در محدوده فرابینخش، کاربرد آن را با محدودیت مواجه ساخته است [۷]. از آنجاییکه قسمت اعظم نور خورشید در ناحیه مرئی قرار دارد [۱۶]، اخیرا مهمترین مساله در مورد فتوکاتالیزورها، بهبود فعالیت فتوکاتالیزوری آنها در ناحیه مرئی می‌باشد. رویکردهای گوناگونی به منظور فعال نمودن فتوکاتالیزورهای دارای باند گپ وسیع در ناحیه مرئی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به دوب کردن نیمه هادی‌ها با



### ۳-۱- بررسی اثر دمای رفلaks

به منظور بررسی اثر دمای رفلaks، مخلوط حاصل از محلول آبی نیترات روی شش آبه و هگزامتیلن تترآمین در دو دمای ۲۰ و ۹۵ °C رفلaks گردید. همانطور که در شکل ۱a دیده می‌شود، نانومیله‌های ZnO با مورفولوژی شکل ای شکل در دمای رفلaks ۷۰ °C به صورت خالص بدست نیامدند. بنابراین دمای ۷۰ °C انرژی کافی را در سنتر نانومیله‌های ZnO فراهم نمی‌کند. دمای ۹۵ °C به عنوان دمای بهینه رفلaks انتخاب شد.

### ۳-۲- بررسی اثر زمان رفلaks

به منظور بررسی اثر زمان رفلaks مخلوط حاصل از محلول آبی نیترات روی شش آبه و هگزامتیلن تترآمین در دمای ۹۵ °C به مدت ۱۸۰، ۵۱۰ و ۱۴۴۰ دقیقه رفلaks شد. تصاویر ۱b و ۱c مربوط به بررسی اثر زمان رفلaks می‌باشد. همانطور که در شکل ۱b دیده می‌شود، سایز قطر نانومیله‌های ZnO سنتر شده در مدت زمان رفلaks ۱۸۰ دقیقه از یکنواختی مناسبی برخوردار نیست. همچنین تصویر ۱c مربوط به زمان رفلaks ۱۴۴۰ دقیقه می‌باشد که ZnO با مورفولوژی خالص نانومیله، حاصل نشده است. بنابراین مدت زمان بهینه برای رفلaks، ۵۱۰ دقیقه بدست آمد.

### ۳-۳- بررسی اثر pH محلول

به منظور بررسی اثر pH محلول در سنتر نانومیله‌های اکسید روی، pH مخلوط حاصل از محلول آبی نیترات روی شش آبه و هگزامتیلن تترآمین با آمونیاک به ۱۱ رسانده شد. تصویر ۱d مربوط به اکسید روی تهیه شده با pH ۱۱ است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود، اکسید روی با مورفولوژی نانومیله تشکیل نشده است. در pHهای بالای ۷، هیدرولیز با سرعت بیشتری انجام شده و دانه‌ها تمایل به رشد سریع دارند [۱۴]. در نتیجه ذرات pH تجمع یافته زیادی تشکیل می‌شود. بنابراین pH=۷ طبیعی محلول‌های نیترات روی و هگزامتیلن تترآمین می‌باشد، به عنوان pH بهینه انتخاب شد.

مولار برابر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش ۵۰ میلی‌لیتر محلول ۱/۰ مولار نیترات روی شش آبه با ۵۰ میلی‌لیتر محلول ۱/۰ مولار هگزامتیلن تترآمین مخلوط کرده و سپس رفلaks گردید. در این مرحله زمان‌های رفلaks ۱۸۰، ۵۱۰ و ۱۴۴۰ دقیقه و دماهای ۷۰ و ۹۵ °C مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر pH محلول‌ها با دو pH برابر با ۷ و ۱۱ مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از انجام واکنش، محلول در دمای اتاق سرد شده و رسوب اکسید روی، با آب دیونیزه شستشو داده شد. محصول نهایی به رنگ سفید مایل به خاکستری است و در آون در دمای ۵۰ °C خشک شد. رسوب خشک شده در دمای ۴۵۰ °C بازپخت گردید.

### ۳-۲- سنتر تتراکیس (۴-کربوکسی فنیل پورفیرین) و کمپلکس قلع آن

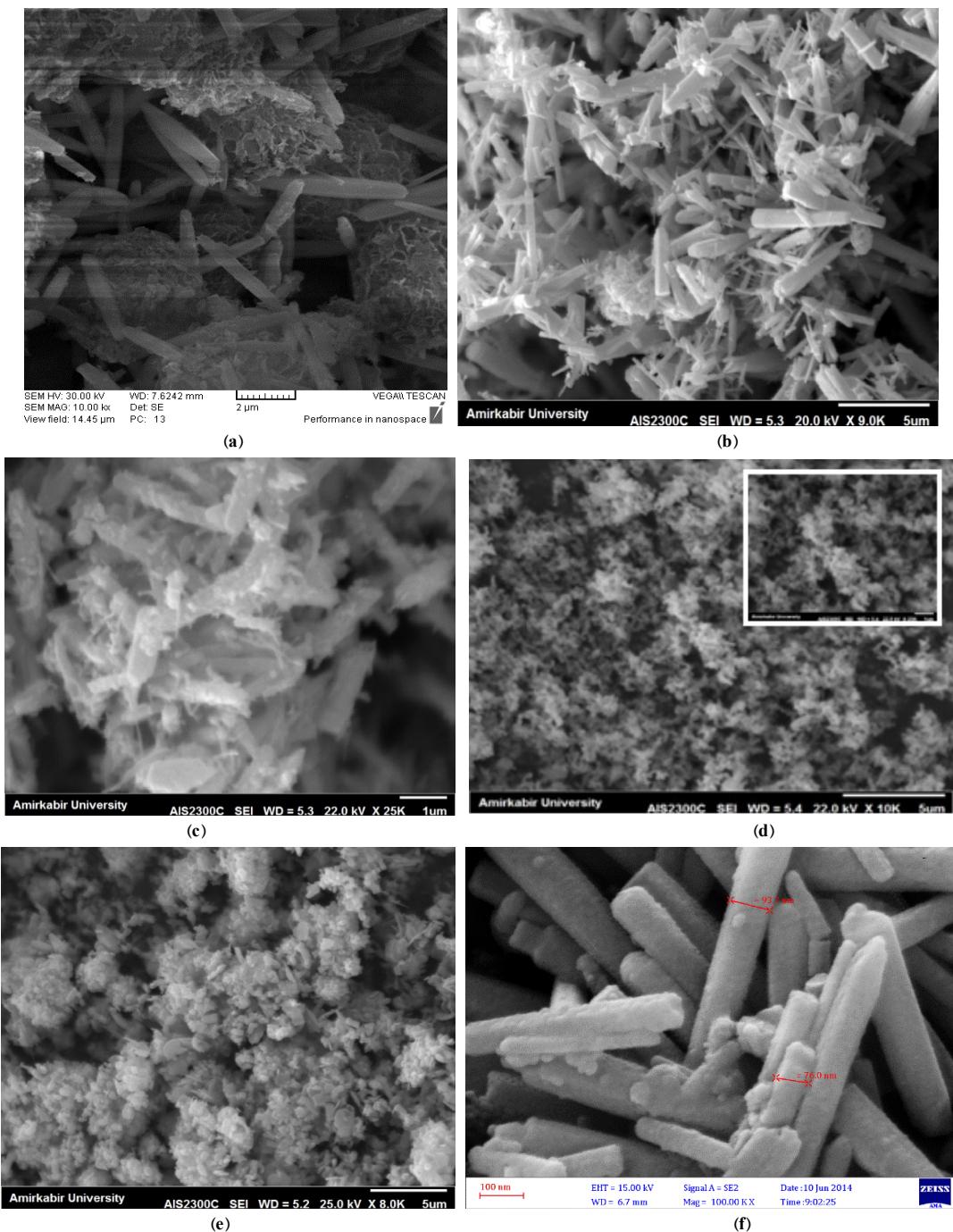
سنتر پورفیرین TCPP مطابق روش ارائه شده در مقالات قبلی سنتر گردید [۳۲]. به منظور سنتر کمپلکس قلع آن، TCPP را در پیریدین حل کرده و با میزان اضافی از نمک SnCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O به مدت ۶ ساعت رفلaks گردید. محلول پس از تبخیر حلal و شستشو با آب بدست آمد.

### ۳-۳- حساس‌سازی نانومیله‌های ZnO با ترکیبات پورفیرین

به منظور حساس نمودن نانومیله‌های ZnO با ترکیبات پورفیرین، ZnO و ترکیبات پورفیرین با نسبت ۱ به ۱۰ در حلال DMF رفلaks شد. پس از شستشو با DMF محصول سنتر شده بدست می‌آید.

### ۳- نتایج و بحث

شکل ۱ تصاویر میکروسکوپ الکترونی اکسید روی‌های سنتر شده را نشان می‌دهد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص نمودند که پارامترهای بهینه در سنتر نانومیله‌های اکسید روی، دمای رفلaks ۹۵ °C به مدت ۵۱۰ دقیقه می‌باشد. دمای pH محلول ۷ و دمای بازپخت ۴۵۰ °C به مدت ۲۴۰ دقیقه تعیین شد.

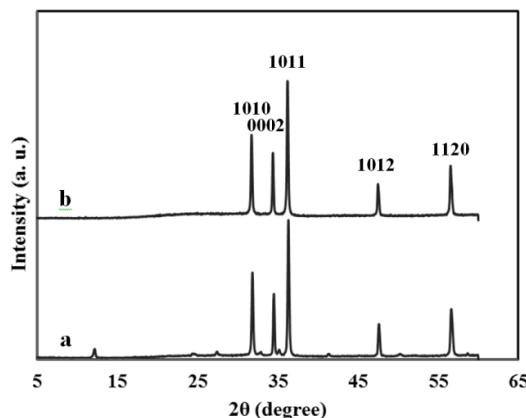
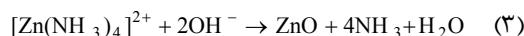
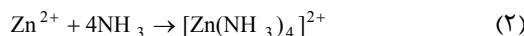
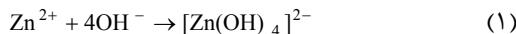


شکل ۱: تصاویر SEM مربوط به بررسی اثر پارامترهای گوناگون در سنتز نانومیله‌های ZnO (a) دمای رفلaks، (b) زمان رفلaks، (c) اثر غلظت ماده اولیه M و pH=11 (d) دقیقه، (e) زمان رفلaks ۱۴۴۰ دقیقه، (f) اثر غلظت محلول مواد اولیه شرایط بهینه.

و هگزامتیلن تترآمین با حجم و مولار برابر با هم مخلوط گردید. در این بررسی محلول‌ها با حجم ۵۰ ml و دو غلظت ۱/۲ و ۰/۱ مولار تهیه شدند. سپس مخلوط حاصل

۴-۳- بررسی اثر غلظت محلول‌های مواد اولیه به منظور بررسی اثر غلظت محلول مواد اولیه در سنتز نانومیله‌های اکسید روی، محلول آبی نیترات روی شش آبه

می‌شود [۳۲]. واکنش‌های مرحله‌ای تشکیل ZnO به صورت زیر است:



شکل ۲: الگوی پراش ZnO سنتر شده، (a) قبل و (b) پس از بازپخت.

### ۷-۳- شناسایی ZnO حساس شده با ترکیبات پورفیرین

نتایج طیف‌سنجی مادون قرمز ترکیبات ZnO-ZnO-SnTCPP و ZnO-TCPP در شکل ۳ نشان داده شده است. پیک مشخصه ZnO مربوط به نوار جذب Zn-O-ZnO در محدوده ۴۰۰-۵۰۰  $\text{cm}^{-1}$  و ارتعاش خمثی Zn-O در محدوده ۳۴۰۰-۴۰۰  $\text{cm}^{-1}$  مشاهده می‌گردد. نوار موجود در شده بر روی ZnO می‌باشد. در ترکیبات ZnO-TCPP و ZnO-SnTCPP پیک مشخصه کربونیل در ۱۶۰۴  $\text{cm}^{-1}$  دلیل بر حضور ترکیبات پورفیرین در نمونه سنتر شده می‌باشد. نوار موجود در حوالی ۱۳۴۰  $\text{cm}^{-1}$  در ترکیبات ZnO-SnTCPP و ZnO-TCPP مربوط به ارتعاشات کششی نامتقارن گروه کربونیل می‌باشد. نوار موجود در

به مدت ۵۰ دقیقه در دمای ۹۵ °C رفلکس گردید. بعد از انجام واکنش رسوب حاصل با آب دیونیزه شستشو داده شد و در آون با دمای ۵۰ °C خشک گردید. رسوب خشک شده در دمای ۴۵۰ °C به مدت ۳۰۰ دقیقه بازپخت شد. تصاویر ۱e و ۱f به ترتیب مربوط به ZnO سنتری با غلظت‌های مواد اولیه ۰/۲ و ۰/۱ مولار می‌باشند. همانگونه که در شکل ۱e دیده می‌شود، با غلظت ۰/۲ مولار از محلول نیترات روی و هگزامتیلن تترآمین، ZnO با مورفولوژی نانومیله تشکیل نشده است. بنابراین عامل غلظت کلیدی ترین پارامتر در کنترل شکل نانومیله‌های ZnO است و حضور غلظت بالای مواد اولیه مانع رشد نانوذرات به شکل میله‌ای می‌شود. در نتیجه غلظت ۰/۱ مولار از مواد اولیه به عنوان غلظت بهینه در سنتر نانومیله‌های ZnO انتخاب شد.

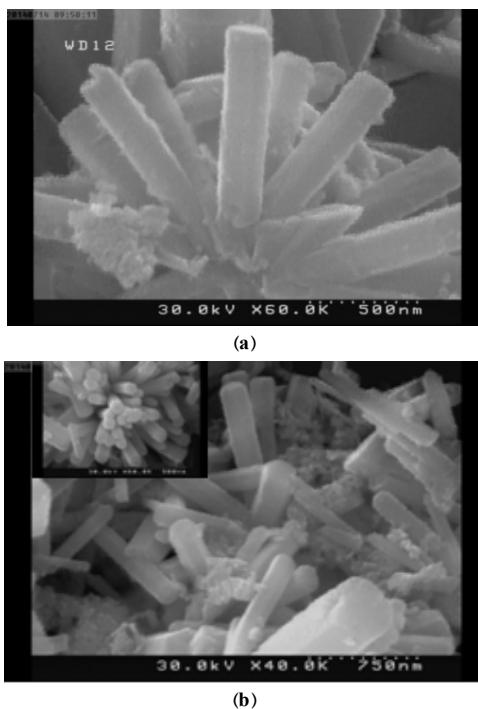
### ۳-۵- بررسی اثر بازپخت

به منظور بررسی اثر بازپخت بر روی تشکیل نانومیله‌های اکسید روی، سنتر شرایط بهینه بدست آمده، انجام شد. شکل ۲ الگوی پراش اشعه ایکس ZnO سنتر شده قبل و بعد از فرآیند بازپخت را نشان می‌دهد. همانگونه که در شکل ۲a مشاهده می‌شود، پیک‌های ضعیفی علاوه بر پیک‌های مربوط به فاز اکسید روی وجود دارد. در شکل ۲b پیک‌های موجود در ۴۷/۴۸، ۵۶/۵۲، ۳۶/۲، ۳۱/۷۲، ۳۴/۳۶ درجه، تشکیل ZnO با ساختار وترزیت هگزاگونال را تأیید می‌کنند که با کارت استاندارد JCPDS ۳۶-۱۴۵۱ مطابقت دارد. پیک مربوط به ناخالصی در الگوی پراش اشعه ایکس ZnO سنتر شده مشاهده نمی‌شود که دلالت بر خلوص بالای نانوذرات ZnO سنتر شده پس از فرآیند بازپخت دارد.

### ۳-۶- مکانیسم تشکیل نانومیله‌های ZnO با ساختار هگزاگونال

در سنتر نانومیله‌های ZnO، محلول آبی نیترات روی و هگزامتیلن تترآمین به عنوان پیش ماده استفاده شده‌اند. هگزامتیلن تترآمین در محلول آبی، یون‌های هیدروکسید (OH<sup>-</sup>) و مولکول‌های آمونیاک (NH<sub>3</sub>) را تولید می‌نماید. بنابراین با مخلوط نمودن دو پیش ماده اولیه، دو کمپلکس

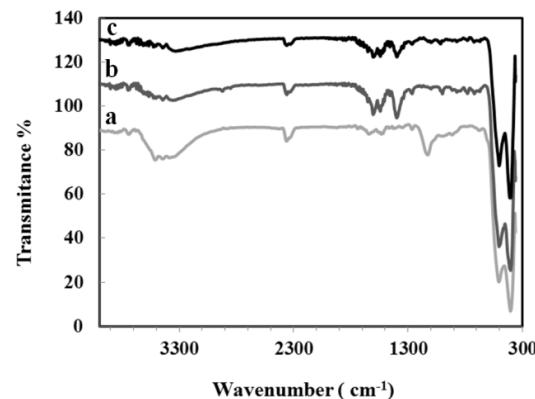
ZnO-SnTCPP و ZnO-TCPP وجود ندارد. بنابراین عامل دار کردن ZnO با ترکیبات پورفیرین، فاصله بین صفحات کریستالی ZnO را تغییر نداده است و ساختار هگزاگونال ZnO حفظ شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روشنی ZnO حساس شده با TCPP و ZnO-SnTCPP در شکل ۵ نشان داده شده است. با توجه به تصاویر ۵a و ۵b، حضور ترکیبات پورفیرین مورفولوژی نانومیله‌های ZnO را تغییر نداده است.



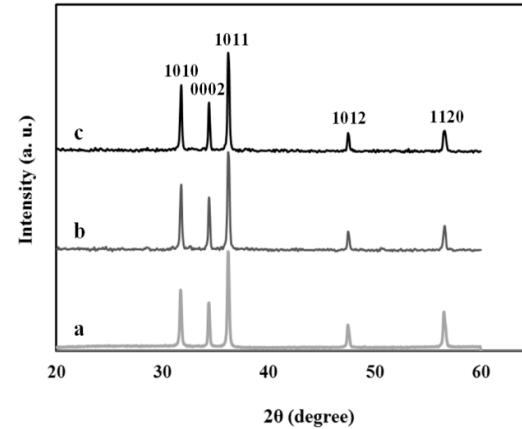
شکل ۵: تصاویر SEM (a) ZnO-TCPP (b) و ZnO-SnTCPP

آنالیز فرابینش انعکاسی حالت جامد ترکیب سنتز شده در شکل ۶ آورده شده است. محدوده جذب نور، نقش مهمی را در فرآیند فتوکاتالیزوری به خصوص تخریب نوری آلاینده‌ها تحت تابش نور مرئی بر عهده دارد. همانطور که از نمودارهای ۶b و ۶c مشخص می‌شود، با پورفیرین دار شدن ZnO، میزان جذب نیز به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. ترکیبات پورفیرین بواسطه دارا بودن طیف جذبی وسیع و ضریب جذب بالا قادر به جذب بالای نور می‌باشند. نتایج مذکور مشخص می‌کنند که فرآیند حساس‌سازی با پورفیرین به میزان زیادی بر روی فعالیت فتوکاتالیزوری ZnO در نور مرئی موثر بوده است.

حوالی  $1540\text{ cm}^{-1}$  در این ترکیبات مربوط به ارتعاشات کششی C=C موجود در حلقه بنزنی است. در ترکیبات ZnO-SnTCP و ZnO-TCPP ۳۴۰۰  $\text{cm}^{-1}$  نوار کاهش یافته است. زیرا با عامل دار کردن ZnO با ترکیبات OH و SnTCPP از طریق برهمکنش تراکمی بین گروه‌های COOH با گروه ZnO موجود در سطح ZnO، میزان گروه‌های OH بر روی سطح ZnO کم شده، بنابراین شدت نوار مربوط به OH موجود در سطح ZnO کاهش می‌یابد. الگوی پراش اشعه ایکس اکسید روی سنتز شده و حساس شده با TCPP و ZnO-SnTCPP در شکل ۴ نشان داده شده است.



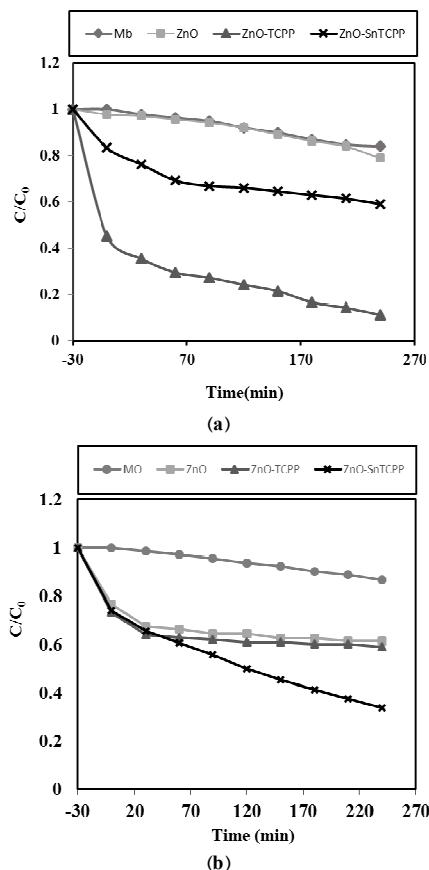
شکل ۳: نمودار FT-IR فتوکاتالیزورهای (a) ZnO (b) ZnO-SnTCPP (c) و ZnO-TCPP (b)



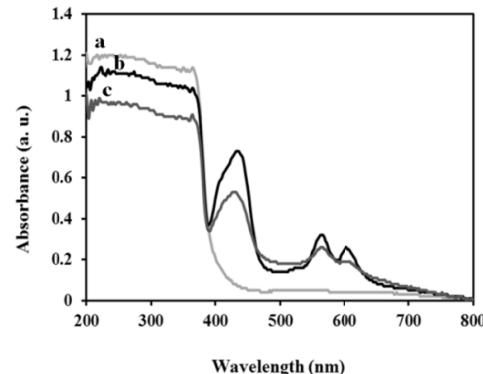
شکل ۴: الگوی پراش اشعه ایکس (a) ZnO (b) ZnO-SnTCPP (c) و ZnO-TCPP (b)

همانگونه که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، تغییر قابل ملاحظه‌ای در الگوی پراش اشعه ایکس ترکیبات

مذکور تحت تابش نور پایدار می‌باشند. از سوی دیگر ترکیب ZnO خالص نیز تخریب نوری قابل ملاحظه‌ای نشان نداد. زیرا ZnO با باند گپ  $\frac{3}{2} \text{ eV}$  در ناحیه فرابنفش فعالیت فتوکاتالیزوری دارد. با توجه به نتایج فتوکاتالیزوری مشاهده شده در شکل ۵، فتوکاتالیزور ZnO-TCPP قادر به تخریب  $89\%$  درصد رنگ متیلن بلو در بازه زمانی  $240$  دقیقه می‌باشد. مکانیسم فرآیند تخریب نوری در ترکیب ZnO-TCPP به این صورت است که ابتدا پورفیرین تحت تابش نور برانگیخته شده و الکترون آن به نوار هدایت نیمه هادی ZnO منتقل می‌شود. الکترون‌ها در این نوار به سطح نیمه هادی انتقال یافته و منجر به تولید  $\text{O}_2^-$  از مولکول  $\text{O}_2$  می‌گردند. حفره‌های باقیمانده در نوار ZnO، منجر به تبدیل  $\text{H}_2\text{O}$  به  $\text{OH}^-$  می‌شوند. والنس گونه‌های تولید شده بسیار فعال بوده و منجر به تخریب مولکول‌های آلایینده رنگی می‌گردد.



شکل ۷: تخریب نوری، (a) متیلن بلو و (b) متیلن اورانژ در حضور فتوکاتالیزورهای سنتز شده (MB: متیلن بلو، MO: متیلن اورانژ).



شکل ۶: نمودار فرابنفش انعکاسی حالت جامد، (a) ZnO (b) ZnO-TCPP و (c) ZnO-SnTCPP

آنالیز فرابنفش انعکاسی حالت جامد مهمترین روش به منظور بررسی عامل دار شدن اکسیدهای فلزی با ترکیبات پورفیرین می‌باشد. نکته قابل توجه دیگر در شکل ۶، حضور نوار سورت و نوارهای Q در ترکیبات حساس شده با پورفیرین است که حضور پورفیرین را در ترکیبات سنتز شده تأیید می‌کند.

### ۸-۳- فعالیت فتوکاتالیزوری ترکیبات

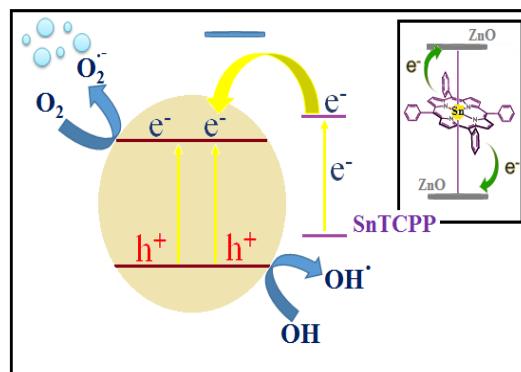
به منظور بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری، فرآیند تخریب نوری دو آلایینده رنگی متیلن اورانژ و متیلن بلو با غلظت  $10 \text{ ppm}$  در حضور فتوکاتالیزورهای مذکور با غلظت  $0.6 \text{ g/l}$  تحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. لامپ مورد استفاده به منظور تامین نور مرئی، LED با توان  $5 \text{ W}$  بود. روش کار به این صورت است که سوسپانسیون‌های تهیه شده بر روی همزن مغناطیسی در معرض تابش نور مرئی قرار گرفتند. به منظور سنجش میزان رنگ جذب شده بر روی کاتالیزور و همچنین ایجاد تعادل جذب-واجدب بین رنگ و کاتالیزور، سوسپانسیون به مدت  $30$  دقیقه در تاریکی همزده می‌شود. پس از این مرحله نوردهی آغاز می‌شود و در فواصل زمانی  $30$  دقیقه از سوسپانسیون‌ها نمونه برداشته شده و جذب نمونه‌ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه‌گیری می‌شود. نتایج فتوکاتالیزوری ترکیبات در شکل ۷ نشان داده شده است. همانطور که در شکل ۷ مشاهده می‌شود، متیلن اورانژ و متیلن بلو در عدم حضور فتوکاتالیزور و تحت تابش نور مرئی، تخریب قابل توجهی نداشته‌اند. بنابراین ترکیبات

تتراکیس (۴-کربوکسی فنیل پورفیرین) و کمپلکس قلع آن حساس شد. فعالیت فتوکاتالیزوری ترکیبات جدید سنتز شده تحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. در ترکیب ZnO-TCPP، ترکیب پورفیرین به عنوان جاذب نور و عامل تزریق الکترون به نیمه هادی ZnO عمل می‌نماید. این ترکیب بواسطه نواحی قوى در طیف UV-Vis، قادر به جذب قوى نور می‌باشد. پورفیرین در حضور نور برانگیخته شده و الکترون تهییج شده آن به نوار هدایت نیمه هادی ZnO منتقل می‌شود. نتایج فتوکاتالیزوری نشان داد که در مدت زمان ۲۴۰ دقیقه از تابش نور ۸۹ درصد از رنگ متیلن بلو توسط فتوکاتالیزور ZnO-TCPP تخریب گردید. نکته قابل توجه در فرآیند فتوکاتالیزوری ZnO-TCPP، میزان جذب بالای رنگ متیلن بلو بر روی فتوکاتالیزور می‌باشد. بواسطه فرآیند جذب، رنگ در مجاورت فتوکاتالیزور قرار گرفته و در نتیجه فرآیند تخریب با بازده بیشتری انجام می‌گیرد. در ترکیب ZnO-SnTCPP به عنوان عامل تزریق الکترون و کانالی جهت انتقال الکترون عمل می‌نماید. حضور اتصالات لیگاند محوری در فرآیند انتقال الکترون از فلز موجود در مرکز حلقة پورفیرین به نیمه هادی ZnO بسیار موثر است.

## مراجع

- [1] S.N. Hussain, N.D. Heras, H.M. Asghar, N.W. Brown, E.P. Roberts, *Water Research*, **54**, 2014, 170.
- [2] R. Rahimi, E.H. Fard, S. Saadati, M. Rabbani, *Journal of Sol-gel Science and Technology*, **62**, 2012, 351.
- [3] R.C. Pawar, C.S Lee, *Applied Catalysis B: Environmental*, **144**, 2014, 57.
- [4] T. Lv, L. Pan, X. Liu, Z. Sun, *Catalysis Science Technology*, **2**, 2012, 2297.
- [5] F. Hashemzadeh, R. Rahimi, A. Ghaffarinejad, *Ceramics International*, **40**, 2014, 9817.
- [6] E. Hong, D. Kim, J.H. Kim, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, **20**, 2014, 3869.
- [7] W. Sun, J. Li, G. Mele, Z. Zhang, F. Zhang, *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, **366**, 2013, 84.
- [8] B.G. Kwon, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, **199**, 2008, 112.
- [9] M. Rabbani, R. Rahimi, M. Bozorgpour, J. Shokraiyan, S. Safalou-Moghaddam, *Materials Letters*, **119**, 2014, 39.
- [10] H. Zhang, J. Yang, D. Li, W. Guo, Q. Qin, L. Zhu, W. Zheng, *Applied Surface Science*, **305**, 2014, 274.
- [11] Q. Amar, M. Saquib, M. Muneeb, *Desalination*, **186**, 2005, 255.
- [12] N. Ueno, T. Maruo, N. Nishiyama, Y. Egashira, K. Ueyama, *Materials Letters*, **64**, 2010, 513.
- [۱۳] صالحی منافی، علی اصغر روحانی، سید حسین بدیعی و امیر صالحی، "تپیه و سنتز نانوساختارهای ZnO با استفاده از فرآیند ژلاسیون و

در ترکیب ZnO-SnTCPP، بواسطه وجود دو لیگاند محوری کلر در SnTCPP.Cl<sub>2</sub>، اتصال بین ZnO و SnTCPP از طریق برهمکنش بین لیگاند کلر در SnTCPP.Cl<sub>2</sub> با گروههای OH موجود در سطح ZnO برقرار می‌گردد (شکل ۸). وجود این اتصال و همچنین فلز مرکزی در انتقال الکترون از پورفیرین به نیمه هادی ZnO بسیار مهم است. انتقال الکترونی مذکور تاثیر بسزایی در تخریب نوری آلاینده‌ها داشته است. در این ترکیب الکترون برانگیخته در پورفیرین از طریق اتصالات محوری به نیمه هادی ZnO منتقل شده و SnTCPP به عنوان کانالی در این انتقال الکترون عمل می‌نماید. نکته قابل توجه در تخریب متیلن بلو، کارآیی بیشتر فتوکاتالیزور ZnO-TCPP می‌باشد. همانطور که از نمودارهای تخریب فتوکاتالیزوری آلاینده‌های رنگ مشاهده می‌شود، جذب رنگ متیلن بلو بر روی فتوکاتالیزور ZnO-TCPP بسیار زیاد می‌باشد. بنابراین رنگ در تماس بیشتر با فتوکاتالیزور بوده و کارآیی تخریب فتوکاتالیزوری افزایش می‌یابد.



شکل ۸: مکانیسم تخریب نوری آلاینده رنگی در حضور ZnO حساس شده با ترکیبات پورفیرین.

## ۴- نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر، نانومیله‌های ZnO با ساختار ورتزیت همگزاگونال و قطره متوسط میله‌های ۹۰ nm به روش همرسوبی سنتز شدند. در روش سنتز، پارامترهای گوناگونی نظیر pH، دما و زمان رفلاکس و بازپخت مورد بررسی قرار گرفت. ZnO بواسطه باند گپ وسیع در ناحیه فرابنفش فعال است. به منظور بهره‌برداری بهینه از نور خورشید، نیمه هادی مذکور برای اولین بار با دو ترکیب

- [22] G.E. Zervaki, M.S. Roy, M.K. Panda, P.A. Angaridis, E. Chrissos, G.D. Sharma, *Inorg. Chem.*, **52**, 2013, 9813.
- [23] S. Karthikeyan, J. Yong-Lee, *Journal of Physical Chemistry A*, **117**, 2013, 10973.
- [24] B. DiStasio, C. Frochot, D. Dumas, P. Even, J. Zwier, A. Muller, J. Didelon, F. Guillemin, M. Viriot, M. Barberi-Heyob, *European Journal of Medicinal Chemistry*, **40**, 2005, 1111.
- [25] M. Ethirajan, Y. Chen, P. Joshi, R.K. Pandey, *Chemical Society Review*, **40**, 2011, 340.
- [26] X. Liang, X. Li, L. Jing, X. Yue, Z. Dai, *Biomaterials*, **35**, 2014, 6379.
- [27] B.A. Cohen, M. Bergkvist, *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, **121**, 2013, 67.
- [28] S. Merouani, O. Hamdaoui, F. Saoudi, M. Chiha, C. Petrier, *Journal of Hazardous Materials*, **175**, 2010, 593.
- [29] J. Shi, X. Yan, H. Cui, X. Zong, M. Fu, S. Chen, L. Wang, *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, **356**, 2012, 53.
- [30] W. Sun, J. Li, G. Yao, M. Jiang, F. Zhang, *Catalysis Communications*, **16**, 2011, 90.
- [31] R. Rahimi, M. Mahjoub-Moghaddas, S. Zargari, *Journal of Sol-gel Science and Technology*, **65**, 2013, 420.
- [32] A. Qurashi, M. Faiz, N. Tabet, M.W. Alam, *Superlattices and Microstructures*, **50**, 2011, 173.
- بررسی ریزساختارهای آن، مجله تحقیقات مواد نانوکامپوزیتی، شماره ۱، ۲۱-۲۶، ۱۳۸۸
- [14] S. Chakraborty, C.S. Tiwary, A.K. Kole, P. Kumbhakar, K. Chattopadhyay, *Materials Letters*, **91**, 2013, 379.
- [15] R. Saravanan, S. Karthikeyan, V.K. Gupta, G. Sekaran, V. Narayanan, A. Stephen, *Materials Science and Engineering C*, **33**, 2013, 91.
- [16] C. Ren, B. Yang, M. Wu, J. Xu, Z. Fu, Y. Lv, T. Guo, Y. Zhao, C. Zhu, *Journal of Hazardous Materials*, **182**, 2010, 123.
- [17] M. Faisal, A.A. Ismail, A.A. Ibrahim, H. Bouzid, S.A. Al-Sayari, *Chemical Engineering Journal*, **229**, 2013, 225.
- [18] D. Chen, D. Yang, J. Geng, J. Zhu, Z. Jiang, *Applied Surface Science*, **255**, 2008, 2879.
- [19] A. Uetomo, M. Kozaki, S. Suzuki, K.I. Yamanaka, O. Ito, K. Okada, *Journal of American Chemical Society*, **133**, 2011, 13276.
- [20] S. Mathew, A. Yella, P. Gao, R. Humphrey-Baker, B.F. Curchod, N. Ashari-Astani, I. Tavernelli, U. Rothlisberger, M. Khaja-Nazeeruddin, M. Gratzel, *Nature Chemistry*, **6**, 2014.
- [21] M.J. Griffith, K. Sunahara, P. Wagner, K. Wagner, G.G. Wallace, D.L. Officer, A. Furube, R. Katoh, S. Mori, A.J. Mozer, *Chemical Communication*, **48**, 2012, 4145.